# Y 掺杂 SrTiO<sub>3</sub> 晶体材料的电子结构计算\*

徐新发 邵晓红\*

(北京化工大学理学院,北京 100029) (2008年7月11日收到 2008年9月18日收到修改稿)

采用基于第一性原理的密度泛函理论平面波超软赝势法,研究了Y掺杂 SrTiO<sub>3</sub>体系的空间结构和电子结构 性质,得到了优化后体系的结构参数,掺杂形成能,能带结构和电子态密度.对比掺杂浓度为 0.125, 0.25, 0.33 时 Sr<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>和 SrTi<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>O<sub>3</sub>的掺杂形成能,发现 Y 替代 Sr 能形成更稳定的结构.对 Sr<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>(x = 0, 0.125, 0.25, 0.33)的结构进行了优化.结果表明 Y 替代 Sr 后,随着掺杂浓度增大,体系的晶格常数逐渐减小,稳定性逐 渐增强.对不同掺杂浓度的 Sr<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> 能带结构的计算结果表明 纯净的 SrTiO<sub>3</sub> 是绝缘体,价带顶在 R 点,导带 底在  $\Gamma$  点,费米能级处于价带顶;掺杂 Y 后,费米能级进入到导带底中,体系呈金属性,掺杂浓度越大,费米能级 进入导带的位置越深,禁带宽度也近似变宽.

关键词:SrTiO<sub>3</sub>,电子结构,掺杂,VASP PACC:7115,7125,7130

# 1.引 言

钛酸锶(SrTiO<sub>3</sub>)由于其奇妙的特性引起了广大 研究者的关注<sup>[1-4]</sup>.它被广泛用于生长高温超导薄 膜的衬底,作为高电容率材料在超晶格和下一代超 大规模集成器件中具有潜在的应用价值<sup>[5,6]</sup>,还应 用于氧化物传感器,光学开关等等.SrTiO<sub>3</sub>材料由 于其掺杂物的不同以及掺杂物浓度的不同表现出不 同的特性<sup>[7-9]</sup>.纯净的 SrTiO<sub>3</sub> 是很好的绝缘体<sup>[10]</sup>, 但是它的导电性通过引入氧空位或者引入替代掺杂 原子能发生改变<sup>[7-16]</sup>,从而由绝缘性转变为金属 性.Klausmeier-Brown等<sup>[17]</sup>发现 Nb 掺杂 SrTiO<sub>3</sub> 能得 到变化的导电特性,为制备半导体/绝缘体/半导体 (S/I/S)和金属/绝缘体/金属等多层结构仪器提供了 参考.SrTiO<sub>3</sub>中引入掺杂还会出现一种奇特性质 ——超异性<sup>[18-24]</sup>

在 SrTiO<sub>3</sub> 掺杂体系研究中,对于 n 型掺杂前人 研究较多, Guo 等<sup>12</sup>研究了 Nb 替代 Ti, Luo 等<sup>[9]</sup>研 究了氧空位和 V 替代 Ti; Yun 等<sup>[25]</sup>使用第一性原理 计算软件 CASTEP 研究了 Sb 替代 Ti,研究发现掺杂 后 SrTiO<sub>3</sub> 的费米能级进入到导带底,从绝缘性变成 了金属性. 对于 p 型掺杂前人研究较少, Luo 等<sup>[9]</sup> 研究了 Sc 替代 Ti,发现掺杂后费米能级进入到价 带顶中,体系从绝缘性变成了金属性. 对于 Y (yttrium)掺杂 SrTiO<sub>3</sub>, Fu 等<sup>[26]</sup>利用实验研究了  $Y_x Sr_{1-\alpha x} TiO_{3-\delta}(x=0,0.035,0.07;\alpha=1.0,1.5)$ 的 微观结构和导电性,发现其为施主掺杂,掺杂后导 电性增强. Huang 等<sup>[27]</sup>从实验上研究了  $Y_x Sr_{1-x} TiO_3$ 在 500℃到 1000℃的导电性,发现在氢中 x = 0.08温度为 800℃时,掺杂体系的导电性最大,为 71 S/ cm. 对于 Y 掺杂 SrTiO<sub>3</sub> 体系的空间结构和电子结构 的模拟计算研究少有报道.

本文用第一性原理计算软件 Vienna Ab-initio Simulation Package(VASP)<sup>28]</sup>通过从头算赝势计算首 先得到了 Sr<sub>1-x</sub> Y<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> 和 SrTi<sub>1-x</sub> Y<sub>x</sub>O<sub>3</sub>(x = 0.125, 0.25,0.33,x 为掺杂浓度)体系的掺杂形成能,接 着优化了 Sr<sub>1-x</sub> Y<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> 不同掺杂浓度的结构,掺杂 前后的能带结构和电子态密度(density of state, DOS)的变化.希望能对开发 SrTiO<sub>3</sub> 型半导体和制备 诸如金属/绝缘体/金属和半导体/绝缘体/半导体 (S/I/S)等多层结构仪器,以及氧化物超晶格提供一 些参考.

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金(批准号:10547103;20236010)和化工资源有效利用国家重点实验室基金资助的课题。

<sup>†</sup> E-mail :shaoxh@mail.buct.edu.cn

# 2. 软件和方法

### 2.1. 计算软件

本文所有计算都是通过基于密度泛函的第一性 原理计算软件 VASP<sup>[28,29]</sup>来完成. VASP 是采用平面 波赝势(或缀加投影波)方法进行从头算的分子动力 学模拟的软件包,将多体量子问题转化为求解一组 自洽的单电子方程. 基于(有限温度下对电子气而 言)局域密度近似,自由能作为电子气密度的泛 函,在每个分子动力学模拟(molecular dynamics, MD)时间步长内精确求解电子气的瞬时基态.其芯 态用赝势(缀加投影波(projector augmented wave, PAW) 或超软赝势(ultrasoft pseudopotentials, USPP))<sup>30]</sup>来描述,电子波函数由一系列的平面波 函数展开,离子和电子的交换关联作用,采用了局 域密度近似(local density approximation, LDA)<sup>31]</sup>或广 义梯度近似(general gradient approximation, GGA)<sup>32]</sup> 来描述.在实空间中计算势的非局域部分并保持正 交化的数目较少,使得电子的自洽迭代计算时间减 少,计算中还采用了如 RMM-DISS 和 blocked Davidson 等算法.

### 2.2. 计算方法及计算细节

SrTiO<sub>3</sub> 具有立方钙钛矿型结构,它的空间群是 *Pm3m*( $O_{h1}$ ),乌科夫坐标为 Sr 1a(0,0,0),Ti 1b (0.5,0.5,0.5),O 3c(0.0,0.5,0.5).即 Sr 原子 在顶角位置,Ti 原子位于体心位置,O 原子位于面 心位置.它的晶格常数为 a = b = c = 0.3905 nm,在 我们的计算中它的理想模型见图 1.



图 1 SrTiO, 单晶胞结构

在我们的计算中,所使用的赝势是超软赝势 (USPP-GGA),离子和电子之间的交换关联作用采 用 Perdew and Wang 91 方案. 平面波截断能为 400 eV,总能计算的收敛标准为  $2 \times 10^{-5}$  eV,进行离子 弛豫时采用准牛顿算法,收敛标准为各个原子之间 的作用力小于  $1 \times 10^{-2}$  eV/Å,布里渊区分割时特殊 点取样采用 Monkhorst-Pack 方案,自洽计算所使用 的格点分割方案为  $5 \times 5 \times 5$ ,非自洽计算所使用的 格点分割方案为  $11 \times 11 \times 11$ .

我们先进行 SrTiO<sub>3</sub> 单晶胞电子结构计算,然后 进行 Sr<sub>1-x</sub> Y<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> 和 SrTi<sub>1-x</sub> Y<sub>x</sub>O<sub>3</sub>(x = 0.125,0.25, 0.33 )体系的 3 种掺杂浓度下掺杂形成能的计算:x= 0.125(2×2×2 超晶胞,40 原子),x = 0.25(2×2 ×1 超晶胞,20 原子),x = 0.33(3×1×1 超晶胞, 15 原子).最后计算得到 Sr<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub> 体系各种情况 的优化结构,掺杂前后的能带结构和电子态密度 (DOS).计算中,我们先对各种结构进行优化,然 后以优化的结构进行静态总能计算得到电荷密度, 最后保持电荷密度不变进行非自洽计算得到能带结 构和电子态密度<sup>[33,34]</sup>.

# 3. 结果讨论

### 3.1. 掺杂形成能

我们分别计算了 Y 掺杂 SrTiO<sub>3</sub> 时, 替位 Sr 和 替位 Ti 的掺杂形成能,其中掺杂形成能  $E(Y \rightarrow Sr)$ 计算方法如下 [35]

 $E_{\rm f}({\rm Y} \rightarrow {\rm Sr}) = E_{\rm tot}({\rm Sr}_{(1-x)}{\rm Y}_x{\rm TiO}_3)$ 

+  $\mu_{\rm Sr}$  -  $E_{\rm tot}$  (SrTiO<sub>3</sub>) -  $\mu_{\rm Y}$ . (1)

同理 Y 替位 Ti 的掺杂形成能 E( Y→Ti )计算公 式如下:

 $E_{1}(Y \rightarrow Ti) = E_{tot}(SrTi_{(1-x)}Y_{x}O_{3})$ 

+  $\mu_{Ti}$  -  $E_{tot}$  (SrTiO<sub>3</sub>) -  $\mu_{Y}$ . (2)

在上面公式中,  $E_{tot}$  (SrTiO<sub>3</sub>),  $E_{tot}$  (St<sub>1-x</sub>) Y<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>),  $E_{tot}$  (St<sub>1-x</sub>)Y<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>)分别为结构优化后纯净 SrTiO<sub>3</sub>, Y 替位掺杂 Sr 和替位掺杂 Ti 后体系的总 能.  $\mu_{Sr}$ ,  $\mu_{Ti}$ 和  $\mu_{Y}$ 分别为 Sr , Ti , Y 原子的化学势, 即 计算体结构 Sr( $Fm\overline{3}m$ ), Ti( $P6_3/mmc$ ), Y( $P6_3/mmc$ )中放入一个原子的能量.

表1是我们计算的15-atom,20-atom和40-atom 超晶胞掺杂体系的掺杂形成能.从表1可以看出, 掺杂形成能随浓度增加变化很小.三种掺杂浓度 下,Y替位Sr掺杂的形成能均远小于Y替位Ti掺 杂的形成能.如对于 40-atom 的掺杂情况,Y 替位 Sr 的掺杂形成能为 2.110 eV,而Y 替位 Ti 的掺杂形成 能超过了它的 3 倍,达到了 6.935 eV.掺杂形成能 越小能形成越稳定的结构,因此应选择用 Y 来替位 Sr 掺杂 SrTiO<sub>3</sub>.

表 1 15-atom 20-atom 和 40-atom 超晶胞的掺杂形成能

超晶胞	40-atom( 0.125 )	20-atom( 0.25 )	15-atom( 0.33 )
<i>K</i> 点数	$5 \times 5 \times 5$	$5 \times 5 \times 7$	$3 \times 7 \times 7$
<i>E</i> <b>í</b> ( Y→Sr )/eV	2.110	2.207	2.297
E₁(Y→Ti)/eV	6.935	7.179	7.396

#### 3.2. 结构优化

对 SrTiO<sub>3</sub> 单晶胞和 Sr<sub>1-x</sub> Y<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>(x = 0.0,

0.125,0.25,0.33)超晶胞进行了结构优化,包括对 各原子位置和晶格参数的优化.通过优化得到了各 种体系稳定结构的晶格参数、相对总能,见表 2.

由表 2,我们发现未掺杂 SrTiO<sub>3</sub>的晶格参数 a = 0.3945 nm,稍大于实验值 0.3905 nm<sup>[13]</sup>. 当掺杂 浓度 x = 0.125 时, a = 0.3942 nm;掺杂浓度 x = 0.25 时, a = 0.3930 nm;掺杂浓度 x = 0.33 时, a = 0.3927 nm. 说明随着掺杂浓度增大,体系的晶格参 数逐渐减小,但变化量非常小.这可能是因为 Y<sup>3+</sup> (0.089 nm)的半径比 Sr<sup>2+</sup>(0.112 nm)的半径稍小. 另外,通过表 2 中各体系的总能比较发现,体系的总能随 Y 掺杂浓度的增加而逐渐减小(四种情况在相同超胞下比较),这也意味着体系的稳定性逐渐增强.

表 2 SrTiO<sub>3</sub> 单晶胞和 Sr<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>(x = 0.0, 0.125, 0.25, 0.33) 超晶胞结构优化的结构参数

$\operatorname{Sr}_{1-x} \operatorname{Y}_{x} \operatorname{TiO}_{3}$	晶格参数( 计算值/实验值 )/nm	相对总能/eV	转化为2×2×2超胞后的总能/eV
$x = 0.0(1 \times 1 \times 1)$	0.39451/0.3905	- 40.265	—
$x = 0.0(2 \times 2 \times 2)$	0.39447/0.3905	- 321.935	- 321.935
$x = 0.125(2 \times 2 \times 2)$	0.39422/—	- 326.684	- 326.684
$x = 0.25 (2 \times 2 \times 1)$	0.39296/—	- 165.622	- 331.244
$x = 0.33 (3 \times 1 \times 1)$	0.39271/—	- 125.294	- 334.117

### 3.3. 能带结构分析

固定电荷密度(由前面自洽计算得到),我们进 行一次能带结构非自洽计算,得到了各种掺杂体系 下的能带结构.计算过程中,我们在 SrTiO<sub>3</sub> 各结构 的布里渊区高对称点的选取规则为  $X \rightarrow R \rightarrow M \rightarrow \Gamma$  $\rightarrow R(X, R, M, \Gamma, R$ 均为布里渊区高对称点,其 中  $\Gamma$  点为布里渊区中心),图 2 即它的布里渊区高 对称点的分布图.

通过计算,我们得到了各种掺杂体系下的能带 结构.图3是SrTiO<sub>3</sub>的单晶胞能带结构,可以看到 费米能级在价带顶(所有的图都是以费米能级作为 坐标的能量零点),且它的价带顶在 R 点,导带底 在 Γ 点,说明它是间接带隙,这与 van Benthem 等<sup>[10]</sup>的结果一致.同时得到能隙带宽度为1.62 eV, 与 Yun 等<sup>[25]</sup>用 CASTEP 计算结果 1.6 eV 一致,与 Guo 等<sup>[36]</sup>用 LMTO-ASA 计算结果 1.8 eV 相近.而实 验值为 3.25 eV(属于绝缘体),计算得到的能隙带 宽之所以只有实验值的一半,这是局域密度泛函的 通常结果.一般认为与局域密度泛函理论中 Kohn-Sham 方程的本征值不能给出系统的激发态能量有 较大关系,使位于导带的电子态能量值比实验值偏小,从而带隙偏小<sup>[37]</sup>,一般能带值与理论值相差 30%—50%.另外,我们发现图 3 中,从 R 点到 M 点的导带较平缓,从 R 点到 M 点的价带也较平缓,这符合传统超导 BCS 理论的要求,说明 SrTiO<sub>3</sub> 有可能成为超导体<sup>[18—24]</sup>.



图 2 布里渊区高对称点



图 3 SrTiO<sub>3</sub> 的单晶胞能带结构

5 (a` 3 3 能量/eV 能量/eV 缺陷能级 -1 -1 -3 -9 -5 -5 X R М X R М R  $\mathbf{5}$ 5 (c) 3 3 能量/eV 能量/eV 缺陷能级 -1-3 -3-5 -5 R M X R М R X 5 5 (e) 3 3 能量/eV 能量/eV -1 缺陷能级 -3 -5

图 4 纯净  $SrTiO_3$  和  $Sr_{1-x}Y_xTiO_3(x = 0.125, 0.25, 0.33)$  三种掺杂浓度下相同超胞的能带结构 (a)  $SrTiO_3(2 \times 2 \times 2)$ 能带结构; (b)  $Sr_{0.75}Y_{0.125}TiO_3(2 \times 2 \times 2)$ 能带结构 (c)  $SrTiO_3(2 \times 2 \times 1)$ 能带结构; (d)  $Sr_{0.75}Y_{0.25}TiO_3(2 \times 2 \times 1)$ 能带结构 (e)  $SrTiO_3(3 \times 1 \times 1)$ 能带结构; (f)  $Sr_{0.67}Y_{0.33}TiO_3(3 \times 1 \times 1)$ 能带结构

R

M

通常我们感兴趣的是费米能级附近能带结构由 于掺杂所引起的变化. 由图 3 可以看出:掺杂前, 费米能级处于价带顶,而由图 4 可看出掺杂后费米 能级进入导带中,这说明 Sb 掺杂改变了 SrTiO<sub>3</sub> 的 导电特性,使它从绝缘性变成了金属性,也说明 Y 替位 Sr 掺杂 SrTiO<sub>3</sub> 是一种电子(施主)掺杂<sup>[9]</sup>.而且 掺杂使得体系的价带顶位置发生移动,但导带底位 置没有变化,始终都在 *G* 点.比较图 3 和图 4,我 们发现 Y 替位 Sr 掺杂 SrTiO<sub>3</sub>,使得体系的价带发生

了明显的变化,但导带底的形状几乎没变.图4(a) 为纯净40-atom SrTiO<sub>3</sub>的超胞能带图,图4(b)为40atom Sr<sub>0.875</sub>Y<sub>0.125</sub>TiO<sub>3</sub>的能带图,比较图4(a)和图

(b)

R

(d)

(f)

М

4(b),我们发现在相同的 40-atom 的超胞下,掺杂在 禁带中引入了缺陷能级,从而使得体系的导电能力 增强.同理比较图 4(c)和图 4(d),图 4(e)和图 4(f)我们发现由于掺杂在禁带中出现了缺陷能级, 从而使得掺杂后的 SrTiO<sub>3</sub> 导电能力增强,且费米能 级处电子态密度不为零,表现为金属性.由于计算 能力的限制,选取的超晶胞太小,掺杂原子之间的 相互作用无法消除,所以呈金属性.若超晶胞足够 大,能消除掺杂原子镜像之间的相互作用,通过掺 杂计算应该还能得到  $Sr_{1-x}Y_xTiO_3$  呈半导体性的 结论.

图 3 中纯净 SrTiO<sub>3</sub> 的能带宽约为 1.62 eV. 由

4(b)我们得到 Sr<sub>0.875</sub> Y<sub>0.125</sub> TiO<sub>3</sub> 的能带宽约为 1.92 eV,由4(d)得到 Sr<sub>0.875</sub> Y<sub>0.125</sub> TiO<sub>3</sub> 的能带宽约为 2.21 eV,由4(f)得到 Sr<sub>0.67</sub> Y<sub>0.33</sub> TiO<sub>3</sub> 的能带宽约为 2.3 eV.可见 Y 替位 Sr 掺杂 SrTiO<sub>3</sub> 使得体系的能隙值 增大,且近似随着掺杂浓度增大而增大.

### 3.4. 电子态密度分析

通过计算,我们也得到了 SrTiO<sub>3</sub> 的单晶胞和 Sr<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>(x = 0.0, 0.125, 0.25, 0.33)超晶胞的 电子态密度(以下各图均以费米能级能量为能量 零点).



图 5 纯净 SrTiO<sub>3</sub> 的单晶胞总态密度和各原子态密度

由图 5 可以看到,对于未掺杂的 SrTiO<sub>3</sub> 单晶 胞,其费米能级处电子态密度为零,这与能带结构 分析结果一致,费米能级应该是位于价带顶,通常 我们关心的是费米能级附近的电子态密度情况.通 过分析 SrTiO<sub>3</sub> 的总态密度和各原子的态密度图,可 以看到,价带顶(*R*点)电子主要由 O 2p 态电子提 供,导带底(Γ点)电子主要由 Ti 3d 提供.这与 Guo 等<sup>[12]</sup>和 Luo 等<sup>[9]</sup>的分析结果一致.

图 6-图 8 分别是 40-atom, 20-atom 和 15-atom

超胞下 Y 掺杂 SrTiO<sub>3</sub>(掺杂浓度分别为 0.125, 0.25, 0.33)的各原子态密度和总态密度图(由图 5 发现 Sr 对费米能级附近及价带顶和导带底的电子态密度贡献很小,几乎可以忽略不计,故图中没有画出,下同).由图 6 可以看出 Sr<sub>0.875</sub> Y<sub>0.125</sub> TiO<sub>3</sub>的价带顶主要由 O 2p 和 Y 5s 电子占据,导带底主要由 Ti 3d 提供,且总态密度图中导带底附近出现了一个附加的小裂缝(与图 5 中的总态密度相比),这应该是Ti 3d 受到 Y 电势的影响;费米能级进入到导带中,

8



图 6 40-atom 超胞 Sr<sub>0.875</sub> Y<sub>0.125</sub> TiO<sub>3</sub> 各原子态密度和总态密度图

且费米能级处的电子态密度值约为 7.85states/eV, 这也说明 Y 替位 Sr 掺杂 SrTiO<sub>3</sub> 后,的确从绝缘性 变成了金属性.

由图 7 中的各原子态密度可以看出,价带顶则 主要由 O 2p 和 Y 5s 电子占据,导带底主要由 Ti 3d 提供. 且总电子态密度图中导带底附近出现了一个 附加的小裂缝(与图 5 中的总态密度相比),这应该 是 Ti 3d 受到 Y 电势的影响,与图 6 的情况相同; 费米能级进入到导带中,且费米能级处的电子态密 度值约为 4.48 states/eV.

由图 8 中的各原子态密度可以看出,导带底 主要由 Ti 3d 和 Y 5s 提供(与图 6 图 7 情况不同), 说明掺杂浓度越大 Ti 3d 与 Y 5s 的相互作用也越 剧烈;而价带顶则主要由 O 2p 和 Y 5s 电子占据. 由总电子态密度图可以看出其价带顶附近出现了 一个附加的小峰(与图 5 中的总态密度相比),这 应该是 O 2p 受到 Y 电势的影响;而且费米能级进 入到导带中,且费米能级处的电子态密度值约为 4.05 states/eV.

比较图 6,7,8 我们发现随着掺杂浓度的增大 费米能级进入到导带中的位置也越深.Sr<sub>0.875</sub> Y<sub>0.125</sub> TiO<sub>3</sub> 中费米能级与导带底相差 0.25 eV,Sr<sub>0.75</sub> Y<sub>0.25</sub> TiO<sub>3</sub> 中费米能级与导带底相差 0.40 eV,Sr<sub>0.67</sub> Y<sub>0.33</sub> TiO<sub>3</sub> 中费米能级与导带底相差 0.48 eV.将三种情 况的费米能级处的电子态密度值转化到相同大小的 超胞下来比较,可以看出费米能级处的电子态密度 值也随着掺杂浓度的增大而增大.

通过以上态密度分析,可知 O 对费米能级处电 子态密度几乎没有贡献,费米能级处电子态密度主 要由 Ti 3d(Sr<sub>0.67</sub>Y<sub>0.33</sub>TiO<sub>3</sub>体系下 Y 5s 的作用也比较 明显)提供.掺杂前,费米能级位于价带顶,体系 为绝缘性;掺杂 Y 后,费米能级进入到导带中,在 费米能级处的电子态密度值不为 0,说明体系呈金 属性.

8



图 7 20-atom 超胞 Sr0. 75 Y0.25 TiO3 各原子态密度和总态密度



图 8 15-atom 超胞 Sr<sub>0.67</sub> Y<sub>0.33</sub> TiO<sub>3</sub> 各原子态密度和总态密度

## 4.结 论

综上所述,我们使用基于密度泛函的第一性原 理计算软件 VASP 优化了  $Sr_{1-x} Y_x TiO_3(x = 0.0, 0.125, 0.25, 0.33$ )的空间结构,计算了其电子结构. 掺杂形成能的计算结果表明:Y 更容易替代 Sr 位置来掺杂. 空间结构参数优化的结果表明:体系 的晶格常数随掺杂浓度增大而减小,稳定性随掺杂 浓度增大而近似逐渐增强. 电子结构结果表明:纯 净的  $SrTiO_3$  为绝缘体,它的价带顶在 R 点,导带底 在 $\Gamma$ 点,费米能级刚好处于价带顶.Y 替位 Sr 掺杂 SrTiO<sub>3</sub>后,费米能级进入到导带中,费米能级处有 电子占据,Sr<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>呈金属性.掺杂浓度越大, 费米能级处有更多的电子占据,而且费米能级进入 导带的位置也越深.对单个原子态密度分析发现, Y 原子对费米能级处电子态密度有贡献,且对其他 原子的态密度分布产生了影响.总之,通过 Y 替位 Sr 掺杂 SrTiO<sub>3</sub>能得到金属性材料.所以可以通过对 SrTiO<sub>3</sub>掺杂及调整掺杂比例来得到不同的导电 特性.

- [1] Tanaka H , Zhang J , Kawai T 2002 Phys. Rev. Lett. 88 027204
- [2] Takahashi K S , Matthey D , Jaccard D , Triscone J M , Shibuya K , Ohnishi T , Lippmaa M 2004 Appl . Phys. Lett. 84 1722
- [3] Pan F, Olaya D, Price J C, Rogers C T 2004 Appl. Phys. Lett. 84 1573
- [4] Kvyatkovski O E 2001 Phys. Solid State 43 1401
- [5] Zhao T , Chen Z H , Chen F , Shi W S , Lu H B 1999 Phys. Rev. B 60 1697
- [6] Eisenbeiser K, Finder J M, Yu Z, Ramdani J, Curless J A, Hallmark J A, Droopad R, Ooms W J, Salem L, Bradshaw S, Overgaard C D 2000 Appl. Phys. Lett. 76 1324
- [7] Higuchi T , Tsukamoto T , Kobayashi K , Ishiwata Y , Fujisawa M , Yokoya T , Yamaguchi S , Shin S 2000 Phys. Rev. B 61 12860
- [8] Evarestov R A , Piskunov S , Kotomin E A , Borstel G 2003 Phys. Rev. B 67 064101
- [9] Luo W D , Duan W H , Steven G L , Marvin L C 2004 Phys. Rev. B 70 214109
- [10] van Benthem K, Elsässer C 2001 J. Appl. Phys. 90 6156
- [11] Fujimori A, Hase I, Nakamura M, Namatame H, Fujishima Y, Tokura Y, Abbate M, de Groot F M F, Czyzyk M T, Fuggle J C, Strebel O, Lopez F, Domke M, Kaindl G 1992 Phys. Rev. B 46 9841
- [12] Guo X G , Chen X S , Sun Y L 2003 Phys. Lett. A 317 501
- [13] Tomio T, Miki H, Tabata H 1994 J. Appl. Phys. 76 5886
- [14] Tokura Y, Taguchi Y, Okada Y, Fujishima Y, Arima T 1993 Phys. Rev. Lett. 70 2126
- [15] Fukushima K , Shibagaki S 1998 Thin Solid Films 315 238
- [16] Gervais F, Servoin J L, Baratoff A, Bednorz J G, Binnig G 1993 Phys. Rev. B 47 8187
- [17] Klausmeier-Brown M E, Virshup G F, Bozovic I, Eckstein J N, Ralls K S 1992 Appl. Phys. Lett. 60 2806
- [18] Koonce C S , Cohen M L , Schooley J F , Hosler W R , Pfeiffer E R

1967 Phys. Rev. 163 380

- [19] Phillips N E , Ho J C , Woody D P , Hulm J K , Jones C K 1969 Phys. Lett. 29 356
- [20] Phillips N E , Triplett B B , Clear R D , Simon H E , Hulm J K , Jones C , Mazelsky K R 1971 Physica (Amsterdam) 55 571
- [21] Binnig G , Baratoff Am Hoenig H E , Bednorz J G 1980 Phys. Rev. Lett. 45 1352
- [22] King-Smith R D , Vanderbilt D 1994 Phys. Rev. B 49 5828
- [ 23 ] Mo S D , Ching W Y , Chisholm M F , Duscher G 1999 Phys. Rev. B 60 2416
- [24] Schooley J F , Hosler W R , Cohen M L 1964 Phys. Rev. Lett. 12 474
- [ 25 ] Yun J N , Zhang Z Y , Deng Z H , Zhang F C 2006 Chinese Journal of Semiconductors 27 1537
- [ 26 ] Fu Q X , Mi S B , Wessel E , Tietz F 2008 Journal of the European Ceramic Society 28 811
- [27] Huang X L, Zhao H L, Shen W, Qiu W H, Wu W 2006 J. Journal of Physics and Chemistry of Solids 67 2609
- [28] Kresse G , Hafner J 1993 Phys. Rev. B 47 558
- [29] Kresse G, Furthmuller 1996 J. Comput Mater Sci. 6 15
- [ 30 ] Kresse G , Hafner J 1994 J. Phys : Condens Matter 6 8245
- [31] Kohn W, Sham L 1965 J. Phys. Rev. A 140 1133
- [32] Perdew J P , Wang Y 1992 Phys. Rev. B 45 13244
- [ 33 ] Richard M M 2004 Electronic Structure : Basic Theory and Practical Methods ( England : Cambridge University ) p172
- [ 34 ] Georg K , Jurgen F 2005 Vienna Ab-initio Simulation Package (Austria : University Wien ) p106
- [ 35 ] Zhang C , Wang C L , Li J C , Yang K , Zhang Y F , Wu Q Z 2008 Materials Chemistry and Physics 107 215
- [ 36 ] Guo X G , Chen X S , Lu W 2003 Solid State Commun . 126 441
- [ 37 ] Jones R O , Gunnarsson O 1989 Rev. Mod. Phys. 61 689

# Calculation of the electronic structure of Y-doped SrTiO<sub>3</sub>\*

Xu Xin-Fa Shao Xiao-Hong<sup>†</sup>

( College of Science ,Beijing University of Chemical Technology , Beijing 100029 ,China )
( Received 11 July 2008 ; revised manuscript received 18 September 2008 )

#### Abstract

The geometrical and electronic structures , and also the dopant formation energies , lattice constants , band structure and density of states ( DOS ) of  $Sr_{1-x}Y_xTiO_3$  with x = 0.0, 0.125, 0.25 and 0.33 are calculated from the first principles of plane wave ultra-soft pseudo-potential method based on density functional theory. The results of dopant formation energy show that Y preferentially enters the Sr site in SrTiO<sub>3</sub>. Electronic structure results show that pure SrTiO<sub>3</sub> is an insulator and the Fermi energy is at the top of valence band. When doped with Y , the Fermi energy of the system goes into the conduction band and the system undergoes an insulator-to-metal transition. Due to the appearance of the carrier impurity from Y doping , there is a significant distortion near the bottommost conduction bands.

Keywords: SrTiO<sub>3</sub>, electronic structure, doping, VASP PACC: 7115, 7125, 7130

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10547103 ,20236010 ) and the State Key Lab of Chemical Resource Engineering.

<sup>†</sup> E-mail :shaoxh@mail.buct.edu.cn